decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application] [Patent number] [Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-185544 (P2001 - 185544A)

(43)公開日 平成13年7月6日(2001.7.6)

(51) Int.Cl.7

酸別配号

FΙ

テーマコード(参考)

H01L 21/3065 C23F 4/00

4/00 C 2 3 F

A 4K057

H 0 1 L 21/302

5F004

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 14 頁)

(21)出願番号

特願2000-299280(P2000-299280)

(22)出願日

平成12年9月29日(2000.9.29)

(31) 優先権主張番号 特願平11-291270

(32) 優先日

平成11年10月13日(1999.10.13)

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71) 出願人 000219967

東京エレクトロン株式会社

東京都港区赤坂5丁目3番6号

(71) 出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 斉藤 昌司

山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1

東京エレクトロン山梨株式会社内

(74)代理人 100095957

弁理士 亀谷 美明 (外2名)

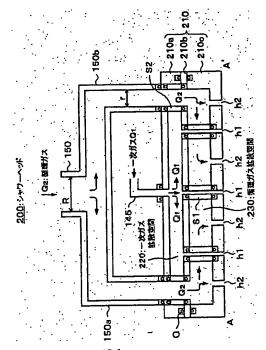
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 処理装置

(57)【要約】

【課題】 循環ガスを容易に制御できる処理装置を提供 する。

【解決手段】 処理ガスを複数のガス供給孔を介して処 理室内に供給するシャワーヘッド200と,処理室11 0内から処理ガスを排気するターボポンプ 120と,タ ーボボンプにより処理室内から排気された排気ガスの少 なくとも一部(循環ガスQ2)をシャワーヘッドに戻す 循環ガス用配管150とを備えた処理装置100は,シ ャワーヘッドは、ガス源140から供給される一次ガス Q1を複数の一次ガス噴出孔h1を介して処理室内に供 給する一次ガス供給系統と、循環ガスを複数の循環ガス 供給孔を介して処理室内に供給する循環ガス供給系統と を備え,一次ガス供給系統と循環ガス供給系統は相互に 独立系統として構成される。処理室内で初めて一次ガス と循環ガスとを混合させることができるため、圧力制御 を行わなくても、循環ガスを容易に制御できる。



JEST AVAILABLE COPY